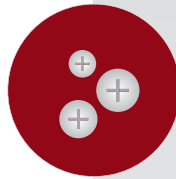


CINOS CLEANING TECHNOLOGY

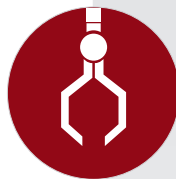
TICTM



Damage Free



Cationizing



Chelation

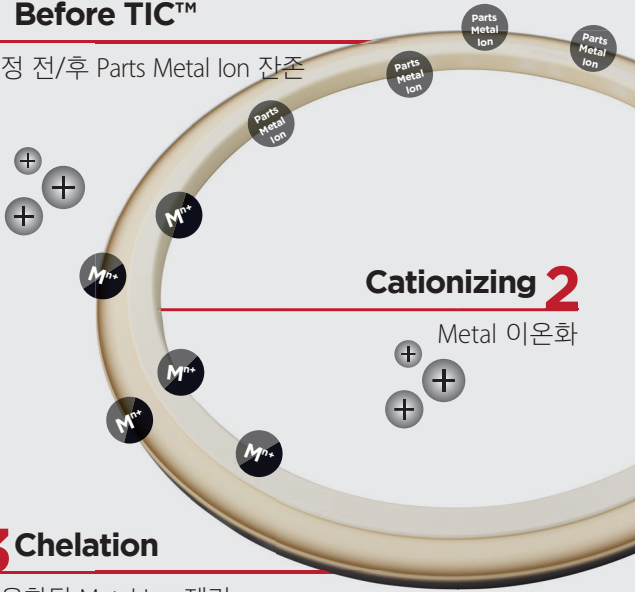
CINOS

Formando Ion Clean

WE MAKE GLOBAL STANDARDS

1 Before TIC™

세정 전/후 Parts Metal Ion 잔존



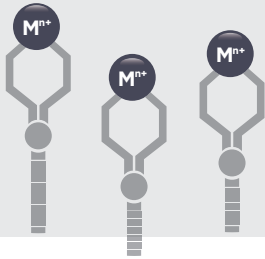
2 Cationizing

Metal 이온화



3 Chelation

이온화된 Metal Ion 제거



Machanism

반도체 공정에서 제품을 세정하기 위해 물리적, 화학적 세정 방식을 적용하고 있으나, 금속 이온을 완전히 세정하기 어렵고, 잔존 금속 이온들로 인해 공정 상 투입된 가스와 이온이 먼저 반응하여 Particle Issue, 수율 저하 등의 다양한 문제의 원인이 됩니다.

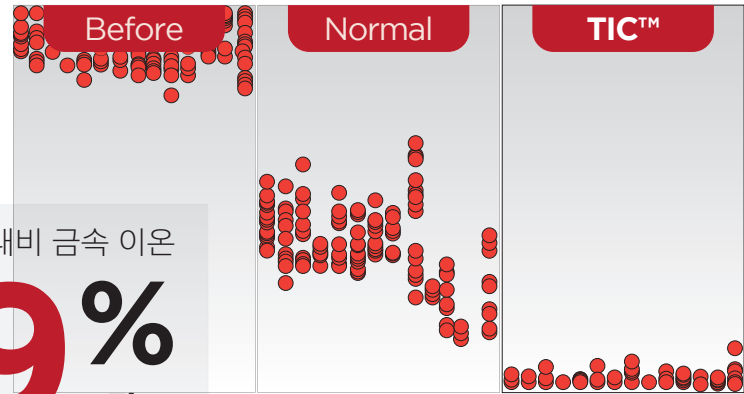
TIC™는 모재 혹은 Coating Surface에 영향을 주지 않고, 금속 이온과 배위 결합할 수 있는 Chelate로 금속 이온을 효과적으로 제거할 수 있는 기술입니다.

Benefits

Damage Free Cleaning



물리적 세정이 아닌 배위 결합(화학적 반응)을 통한 세정 방법



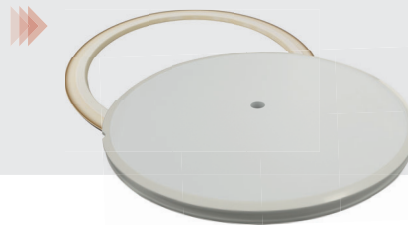
일반 세정 대비 금속 이온
79% 감소

Application

Best Solution For Metal Ion Cleaning

- Ceramic
- Aluminum
- SUS
- Quartz
- Anodizing

Ceramic



Aluminum+Anodizing



SUS



Quartz

